

Aka-Brief #13 Composants électroniques

1



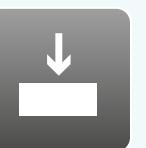
Rhaco Grit
P320



Water



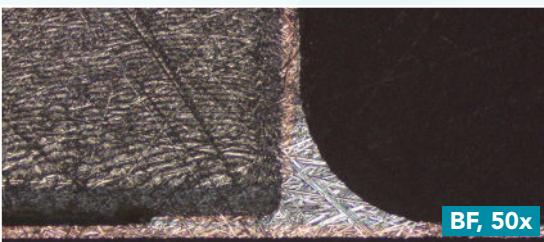
300 rpm



20 N



Until plane



BF, 50x

2



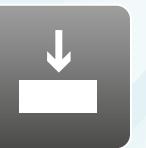
Lagan 9



DiaUltra
9 µm



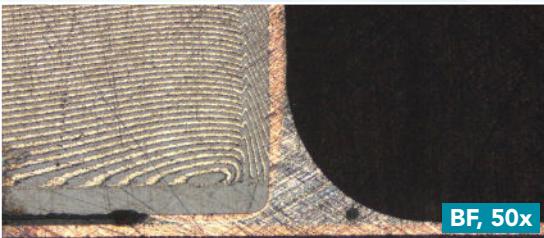
150 rpm



30 N



3:00 min



BF, 50x

3



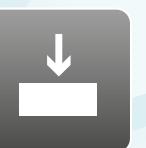
Daran



DiaUltra
3 µm



150 rpm



25 N



3:00 min



BF, 50x

4



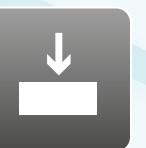
Chemal*



Fumed Silica
0.2 µm
Alkaline**



150 rpm



15 N



2:00 min



BF, 50x

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %.

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

* Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

* Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage.

** 96 ml Fumed Silica,
2 ml H₂O₂ (30%),
2 ml NH₄OH (25%).

Le mélange doit être utilisé frais (dans les deux heures qui suivent) et remué régulièrement.

Veillez à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la manipulation des produits chimiques.

SQMECO

Aka-Brief #13 Composants électroniques

SOMEKO

RÉSULTAT FINAL

